究極の多孔質材料 - シリカエアロゲル-

片桐成人*,** · 安達信泰* · 太田敏孝*

*名古屋工業大学先進セラミックス研究センター 〒 507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘 10-6-29 **リンナイ株式会社 開発本部 〒 480-0133 愛知県丹羽郡大口町替地 3-1

Ultimate Porous Material

- silica aerogel -

Naruhito Katagiri, *, ** Nobuyasu Adachi, * Toshitaka Ota*

*Advanced Ceramics Research Center, Nagoya Institute of Technology 10-6-29 Asahigaoka, Tajimi, Gifu, 507-0071, JAPAN

**Technology Development Center, Rinnai Corporation

3-1 Kaechi, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi, 480-0133, JAPAN

Abstract

Aerogel is an ultra-porous material derived from a gel, in which the liquid component of the gel has been replaced with air. Usually, it is prepared by a supercritical drying using carbon dioxide. In this review, we introduce how to make silica aerogel as the most typical aerogel.

Key-words

Silica Aerogel, Sol-Gel, Supercritical drying, Porous Material

1. はじめに

エアロゲルは、ウェットゲル中に含まれる液体を超臨 界乾燥によってほとんど収縮させず気体に置換した多孔 質体と定義される。エアロゲルの歴史は、意外にも古く、 1931 年にスタンフォード大学の S. S. Kistler の報告¹⁾ が最初であった。彼は、その報告の中で溶媒間において 混和が可能であるならば、例えば水からアルコール、ア ルコールからエーテルといったように容易に種類の異な る溶媒に置換することができ、ゲル構造が置換される溶 媒に依存しないことから液体を気体に置換することは可 能ではないかと考えた。しかし、通常の方法で溶媒を蒸 発させた場合、気液界面における表面張力が生じるため ゲルは著しく収縮し、その骨格構造は破壊に至る。そこ で、ウェットゲルをそれと同じ溶媒で満たしたオートク レーブ内にセットし、溶媒の臨界点以上の温度、圧力に することで気体と液体の区別がつかない状態、すなわち 超臨界状態とした後、溶媒を徐々に除去することで収縮 をさせることなくウェットゲルを乾燥することに成功し た。また彼は、同時にシリカエアロゲル以外にアルミナ、 酸化スズ、酸化タングステン、ゼラチン、寒天、セルロー

スなど無機系、有機系のエアロゲルの作製も行った。

その後、1960年代後半に S. J. Teichner らによるシリ コンアルコキシドを用いたウェットゲルの作製方法の開 発²⁾によって作製時間が大幅に短縮した。1970年代に 入るとシリカエアロゲルの透明性と低屈折率を利用した チェレンコフ検出器用媒体の開発が進められ³⁾、1980 年代の初めに大型のモノリシックシリカエアロゲルの作 製技術が開発された⁴⁾。1980年代では、オイルショッ クの影響を受け省エネルギー技術への応用としてシリカ エアロゲルの透明断熱材料としての研究が進められ た⁵⁾。それと同時に安全な製造プロセスの開発も進めら れ、出発原料であるシリコンアルコキシドは、これまで のオルトケイ酸テトラメチルから毒性のないオルトケイ 酸テトラエチルへ転換され⁶、超臨界乾燥に用いる媒体 は、引火性のアルコールから安全な二酸化炭素へ転換さ れた⁷⁾。また、これまでの無機エアロゲルの作製技術の 利用により、レゾルシノール-ホルムアルデヒド (RF) エアロゲルやメラミン-ホルムアルデヒドエアロゲルと いった有機エアロゲルが開発された^{8),9)}。さらに RF エ アロゲルの熱分解によるカーボンエアロゲルも1980年 代末に開発された⁹⁾。

1990年代では、シリカエアロゲルを中心にそれ以外の金属酸化物のエアロゲル、有機無機複合エアロゲルの研究が進められ、また、エアロゲルの疎水化処理によるスプリングバックを利用した超臨界乾燥を用いない作製方法¹⁰⁾(定義的には、エアロゲルではない)や急速超臨界乾燥による作製技術の検討¹¹⁾が始まった。そして、 NASAは、宇宙船用の断熱材や宇宙塵捕集材といった特殊な用途にシリカエアロゲルを用いた。

2000 年代に入るとエアロゲル研究は、これまでの勢いを失い始めたが、これをターニングポイントにエアロゲルの構造や特性に関する基礎研究、シリカ以外の新規 エアロゲルの開発、カーボンエアロゲルに関する研究、 常圧乾燥によるエアロゲル相当材料の開発等、現在も精力的に研究が行われている。

本稿では、エアロゲルの中で最も代表的であるシリカ エアロゲルについて、田尻及び依田らの報告^{12),13)}を参 考にして、その作製方法や特性を当研究室で改良した結 果をもとに解説する。

2. シリカエアロゲルの作製方法

シリコンアルコキシドを出発原料としシリカエアロゲルに至るまでを大別するとゲル化プロセス、液相置換と 熟成プロセス、疎水化プロセス、超臨界乾燥プロセスといった4つのプロセスから構成される。

プロセス1 シリコンアルコキシドの加水分解・重縮 合によるシリカウェットゲルの作製

一般的に用いられるシリコンアルコキシドは、オルト ケイ酸テトラメチル (TMOS $Si(OCH_3)_4$) とオルトケ イ酸テトラエチル (TEOS Si $(OC_2H_5)_4$) がある。我々 は、ゲルの透明性が高く、酸触媒を必要とせずアンモニ ア触媒のみでゲル化できることを理由に TMOS を用い た実験を行った。まず TMOS をエタノールで希釈した。 この希釈率を低く設定すると短時間でゲル化が生じ、得 られるエアロゲルの密度も高くなった。反対に希釈率を 高く設定すると得られるエアロゲルの密度は低くなった が、ゲル化に長時間を要し作業効率が悪くなった。これ らを考慮し、希釈率は、TMOS:エタノールのモル比 で1:11に設定した。次にTMOS / エタノール混合溶 液に加水分解に必要な水とアンモニア触媒を添加した。 その結果、一般的に言われる以下のような反応が生じ た¹⁴⁾。TMOS は、加水分解によって(2-1)式に示され るように Si(OH)₄を生成した。

 $Si(OCH_3)_4 + 4H_2O \rightarrow Si(OH)_4 + 4CH_3OH$ (2-1)

この Si(OH)₄ は、非常に反応性が高く、すぐに重縮 合して (2-2) 式に示すように SiO₂ 粒子を生成して溶液 はゾルになり、さらに反応の進行にともなって次第に流 動性が失われゲルとなった。 $nSi(OH)_4 \rightarrow (SiO_2)n + 2nH_2O$

なお、樹脂型への注入は、アンモニア触媒を添加し5 分間攪拌してから行った。また、樹脂型には、離型時に シリカウェットゲルが破損するのを防止するため内面に ワセリンを塗布した。エタノールによる TMOS の希釈 から樹脂型からの脱型までが、プロセス1である。

(2-2)

プロセス2 シリカウェットゲルの液相置換と熟成

脱型後、得られたシリカウェットゲルに対しエタノー ルへの液相置換を行った。これによりゲル液相中に残存 する水とアンモニア触媒を除去し、さらに熟成すること によりゲルの骨格構造の強化をはかった。図1は、エ タノール中で50℃にて2時間を1サイクルとする置換 回数によるシリカウェットゲル中の残存水分量の変化を 示す。5回の置換を繰り返すことによってシリカウェッ トゲル中の残存水分は10%以下となり、さらに置換を 繰り返しても残存水分の大幅な減少はなかった。この結 果から置換回数は、5回とした。





プロセス3 シリカウェットゲルの疎水化処理

シリカエアロゲルは、シリカ粒子の表面に親水性のシ ラノール基(Si-OH)を持つため吸湿性があり空気中の 水分を容易に吸着する。その結果として、透明性や断熱 性といった光学的、熱的特性の低下が生じる。疎水化処 理は、(2-3)及び(2-4)の化学反応式に示されるよう にシラノール基中のHを、例えば疎水性のトリメチル シリル基(Si(CH₃)₃)などに置換することでこれら特 性の低下を防止できる。

 $\begin{aligned} \text{Si-OH} + (\text{CH}_3)_3 \text{SiCl} &\rightarrow \text{Si-OSi}(\text{CH}_3)_3 + \text{HCl} \quad (2\text{-}3) \\ 2(\text{Si-OH}) + ((\text{CH}_3)_3 \text{Si})_2 \text{NH} &\rightarrow \end{aligned}$

 $2(Si-OSi(CH_3)_3) + NH_3$ (2-4)

疎水化処理剤は、シラノール基と反応する官能基と疎 水基を有するものであり、官能基としては、ハロゲン、 アミノ基、イミノ基、水酸基などがあり、疎水基として は、アルキル基、フェニル基などがある。本研究では、 疎水化処理の副生成物による悪影響(例えば HCl によ る試験装置や治具の腐食)などを考慮し、官能基がアミ ノ基、疎水基がメチル基であるヘキサメチルジシラザン (((CH₃)₃Si)₂NH)を選定した。これをトルエンに溶解 して 1.3mol/L 溶液とし、110℃、24 時間の条件下で還 流加熱処理することにより疎水化できた。

プロセス4 超臨界乾燥

超臨界乾燥法とは、液体から気体への移行において、 図2に示すように超臨界状態を経由(矢印のルート)す ることで表面張力を発生させずに乾燥を行う方法であ る¹⁵⁾。超臨界媒体としては、二酸化炭素やアルコール などがあるが、本研究では、引火性がなく臨界温度が 31.1℃と低く安全に超臨界乾燥が行えることから二酸化 炭素を用いた。



Fig. 2 Phase diagram of carbon dioxide.¹⁵⁾

超臨界乾燥における具体的な条件や操作方法に関する 情報は少なく、種々の情報^{12),16),17)}を参考にして試行し た。図3は、超臨界乾燥に用いた装置で市販の耐圧硝 子工業製 TAS-06 型である。この装置に対し、加熱方法、 二酸化炭素供給過程、二酸化炭素排出方法などを改良し ながら実験を行った。表1は、代表的な試行例で、超 臨界乾燥プロセス条件と処理後の外観について示す。液 化二酸化炭素を置換媒体として用いた1)と2)のプロ セスでは、置換を数回繰り返し行ってもシリカウェット ゲル内部に残留したエタノールの表面張力により得られ たサンプルに収縮やひび割れが生じた。超臨界二酸化炭 素を置換媒体として用いた場合、3)のプロセスに示さ れるように長時間処理を行っても1回の置換だけでは、 シリカウェットゲル内部のエタノールは、完全に置換さ れなかった。しかし、5回繰り返し置換を行った4)の プロセスでは、エタノールが超臨界二酸化炭素に完全に 置換されたため、図4に示すような収縮やひび割れの ない透明なエアロゲルが得られた。



Fig. 3 Appearance of the carbon dioxide supercritical drying equipment.

	Table 1	A typical	supercritical	drying p	process and	the appearance	e after treatment
--	---------	-----------	---------------	----------	-------------	----------------	-------------------

	state of CO ₂	temperature pressure	number of substitution	treatment time	after treatment
1) liquid	1:	room temp.	1	21	shrinking
	liquid	9MPa	1	30	cracking
2) liquid	1:	room temp.	5	(1	shrinking
	liquid	9MPa	5	011	cracking
3) supercritic	aunoraritical	40°C	1	24b	shrinking
	supercritical	9MPa	1	2411	cracking
4) sup	aunoraritical	40°C	5	<u>(h</u>	unchanca
	supercritical	9MPa	5	no	unchange



Fig. 4 Appearance of silica aerogel.

3. シリカエアロゲルの諸特性

表2に作製したシリカエアロゲルの諸物性を文献 値¹⁸⁾と比較して示す。本実験で作製したシリカエアロ ゲルの嵩密度は0.126g/cm³、気孔率は94.3%、比表面 積は710m²/gで、いずれも文献値の範囲内であった。

図5は、シリカエアロゲルの細孔径分布を示す。シ リカエアロゲルのマクロ気孔領域におけるメジアン径は 2µm 前後であった。一方、メソ気孔領域におけるメジ アン径は14nm であり、表2の文献値とほぼ同じであっ た。

図6は、シリカエアロゲルのSEM及びTEM像を示す。 図 6 (a) の SEM 像では、シリカエアロゲルは、50nm 程度の粒子として観察され、三次元的に網目状の骨格構 造を形成していた。それは、ちょうど粒子の鎖が気泡を 取り囲んでいるように見えた。そこでマクロ気孔である 気泡の径をインターセプト法¹⁹⁾を用いて測定した結果、 気孔径は、1~2µmと推定された。このサイズは、図 5(a)に示される約2µmの気孔とほとんど一致していた。 また、図6(b)のTEM像では、2~3nmの1次粒子 が観察され、表2の文献値と一致した。そして、これ ら粒子は、三次元的に網目状の骨格構造を形成し、それ は 1/10 のスケールであるが、図6(a)の SEM 像で示 されるものと類似した構造であった。すなわち、網目状 の骨格構造は、マクロ気孔からメソ気孔までフラクタル に保持されていると考えられた。また、網目状の骨格構 造中でナノ粒子によって取り囲まれた気孔径は、約10 ~ 20nm であり、表2の文献値及び図5(b) に示され る気孔径と非常に良く一致した。

図4に示したようにシリカエアロゲルの透明性は非 常に高く、下の図柄や文字を明確に見ることができた。 図7は、シリカエアロゲルの光透過率を示す。紫外領 域では、微粒子によるレイリー散乱²⁰⁾のため光透過率 は低くなったが、可視及び近赤外領域では、非常に高い 光透過率を示した。



Fig. 5 Pore size distribution of silica aerogel.



Fig. 6 (a) SEM and (b) TEM image of silica aerogel.

片桐成人・安達信泰・太田敏孝

 Table 2 Physical properties of silica aerogel

		This study	Literature values ¹⁸⁾
Bulk density	(g/cm ³)	0.126	0.0011 - 0.650
Porosity	(%)	94.3	70.5 - 99.95*
Specific surface area	(m^2/g)	710	500 - 950
Primary particle size	(nm)	2 - 3	2 - 3
Average mesopore size	(nm)	14	20
Average macropore size	(μm)	around 2	

*Calculated value from bulk density





4. おわりに

シリカエアロゲルは、究極の多孔質材料であり、超低 密度、大きな比表面積、高い光透過率、低屈折率、低熱 伝導率など、その諸特性は他の材料と比べ大変特異なも のである。これらの特性を断熱材、触媒担体へ応用すれ ば、これまでにない高いパフォーマンスを示すことは十 分に期待できる。しかし、構造の脆弱性や超臨界乾燥に よる高い製造コストが、シリカエアロゲルの用途開発の 大きな障壁になっている。現在、有機材料とのハイブリッ ド化によるこれら課題の克服が検討されている²¹⁾。さ らに我々は、新規の用途開発に向けた機能性材料との複 合化による機能性エアロゲルの創製を検討中である。

参考文献

- 1) S. S. Kistler, *Nature*, **127**, 3211, 741(1931)
- G. A. Nicolaon, S. J. Teichner, Bull. Soc. Chim. France, 1968, 1906(1968)
- A. Linney, B. Peters, Nucl. Instr. and Meth., 100, 545(1972)
- G. Poelz, R. Riethmüeller, Nucl. Instr. and Meth., 195, 491(1982)

- M. Rubin, C. M. Lampert, Solar Energy Mater., 7, 393(1983)
- A. Hunt, A. Michael, Silica Aerogels, Micro- structured Materials Group Lawrence Berkely National Laboratory, http://eetd.lbl.gov/ecs/aerogels/
- P. H. Tewari, A. J. Hunt, K. D. Loffus, *Mater. Lett.*, 3, 363(1985)
- 8) R. W. Pekala, J. Mater. Sci., 24, 3221(1989)
- R. W. Pekala, C. T. Alviso, F. M. Kong, S. S. Hulsey, J. Non-Cryst. Solids, 145, 90(1992)
- D. M. Smith, R. Deshpande, C. J. Brinker, A. J. Hurd, Ceramic Transactions, 31, 71(1993)
- 11) J. F. Poco, P. R. Coronado, R. W. Pekala, L. W. Hrubesh, *MRS Proceedings*, **431**, 297(1996)
- K. Tajiri, Ph. D. thesis, Nagoya Institute of Technology (2002)
- 13) S. Yoda, S. Ohshima, J. Non-Cryst. Solids, 248, 224(1999)
- 14) 作花済夫「ゾル-ゲル法の科学」アグネ承風社 (1998) pp8-13
- 15) 化学工学会 超臨界流体部会ホームページ http://www2. scej.org/scfdiv/
- 16) 園田健二・横山勝・横川弘・椿健治 松下電工株式会社 日本特許 P3339393(2002)
- 17) 生津英夫 日本電信電話株式会社 日本特許 P3492528 (2003)
- 18) Aerogel.org, http://www.aerogel.org/
- 19) J. C. Wurst, J. A. Nelson, J. Am. Ceram. Soc., Discussions and Notes, 2, 109(1972)
- 20) 作花済夫「ゾル-ゲル法応用の展開」シーエムシー出版 (2008)pp110-111
- K. Kanamori, M. Aizawa, K. Nakanishi, T. Hanada, J. Sol-Gel Sci. Technol., 48, 172(2008)